高次光渦ビームによる光渦レーザー吸収分光法の最近の進展

日大生産工(院) 〇皆川裕貴 高知工科大 小林 弘和 核融合研 吉村 信次 九大総理工 寺坂 健一郎 核融合研 森崎 友宏 日大生産工 荒巻 光利

1. 序論

光渦とは、ラゲール・ガウシアン (Laguerre-Gaussian:LG) モードの中心に生じる螺旋状 の等位相面を持つ光波である.光渦中を運動す る粒子は螺旋状の等位相面によって、方位角方 向への追加のドップラー効果を感じる.我々は、 このような方位角方向へのドップラー効果を 利用し、プローブビームを横切る粒子の速度分 布を測定可能な光渦レーザー吸収分光法

( Optical vortex absorption laser spectroscopy: OVLAS) を開発している. 光渦 の伝播方向を横切る粒子のドップラーシフト は光渦のローカルな位相勾配に依存したもの となる. したがって, ビーム断面上にはドップ ラーシフトの二次元分布が存在する. ビーム断 面上において局所的に異なるドップラーシフ トは、プローブビームの共鳴周波数からの離調 に依存した不均一な吸収率分布を生じさせる. 横方向への一様な流れのあるプラズマ中を伝 播するLGビームは、不均一に吸収されながら 伝播していくため、ビーム断面に基本LGモー ドとは異なる構造が生じる. このような基本 LGモードとは異なる構造は高次のLGモード の重ね合わせで表されるため、一連のLGモー ドに分解することができる. 伝播距離に依存し た固有の位相シフトであるGouy位相シフトは LGモードの次数ごとに異なるため、このよう なLGモードの重ね合わせで表される構造は、 伝播によるGouy位相シフトの違いによって変 形していくと考えられる. ビーム断面の構造の 不要な変形は、観測されるドップラースペクト ルも変形させる可能性があるため、その影響を 明らかにする必要がある.本講演では,吸収に よって生じたビーム断面の構造が伝播によっ て受ける影響を数値計算し,実験と比較するこ とで詳細に報告する.

2. ラゲール・ガウシアンモード LGモードは近軸近似下のヘルムホルツ方程 式を円筒対称な解を仮定して,解くことで Eq.1のように得られる[1].

$$\begin{aligned} u_{\ell p}(r,\phi,z) &= \\ &= \sqrt{\frac{2p!}{\pi(p+|\ell|)!}} \left(\frac{\sqrt{2}r}{w(z)}\right)^{|\ell|} \cdot L_p^{|\ell|} \left[\frac{2r^2}{w(z)^2}\right] \\ &\cdot \frac{w_0}{w(z)} \exp\left[-\frac{r^2}{w(z)^2}\right] \cdot \exp[i\ell\phi] \cdot \Psi_G(z) \\ &\cdot \exp\left[-i\frac{kr^2}{2R(z)}\right]. \end{aligned}$$
(1)

ここでは、ビームウェスト位置を原点 (z = 0) としている. kは波数,  $L_p^{[\ell]}(x)$ はラゲール陪多項 式で、pは動径方向、 $\ell$ は方位角方向のモード指 数を表す. w(z),  $w_0$ はそれぞれ最低次モードに おける伝播距離zでのビーム径、ビームウェス ト位置でのビーム径で、R(z)は伝播距離zにお ける曲率半径を表す. Eq.1における、 $\exp(i\ell\phi)$ が方位角方向への位相項である. 光渦の中心は 位相が定まらず、この中心点のことを位相特異 点と呼ぶ.  $\Psi_G(z)$ は平面波との位相のずれであ るGouy位相を表し、次のように与えられる.

$$\Psi_p^{\ell} = (2p + |\ell| + 1) \arctan\left(\frac{z}{z_R}\right).$$
 (2)

ここで、 $z_R$ はレイリー長と呼ばれ、ビーム径が  $\sqrt{2}w_0$ となるビームウェストからの距離を表す. Gouy位相は、最低次モードにおいてはレイリ 一長 $z_R$ で $\pi/4$ 変化し、モード指数によって異な ることが分かる.

## 光渦中の粒子が感じるドップラーシ フト

光渦中の原子は,通常の縦ドップラー効果に 加えて方位角方向へのドップラー効果によっ て共鳴周波数のドップラーシフトを感じる[2].

$$\delta \approx -kV_z - \left(\frac{\ell}{r}\right)V_\phi$$
 (3)

 $V_z$ ,  $V_\phi$ は, それぞれ伝播方向, 方位角方向への原子の速度, rは位相特異点からの距離を表す. 右辺第2項が方位角方向へのドップラーシフトを与える. この効果を測定することで, プローブビーム中の粒子の方位角方向速度成分を得ることができる.

Recent progress in optical vortex laser absorption spectroscopy using higher-order optical vortex beams

Hiroki MINAGAWA, Hirokazu KOBAYASHI, Shinji YOSHIMURA, Kenichiro TERASAKA and Mitsutoshi ARAMAKI

 光渦によるドップラースペクトル 円筒座標系における速度分布において,光渦 の螺旋状の等位相面によって励起される粒子 をEq.3におけるδの関数として考えることで, 以下のように光渦によって観測されるドップ ラースペクトルを得ることができる[3]. f(δ)

$$= \left(\frac{m}{2k_{B}T}\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{r^{2}}{\ell^{2}}k^{2}\right)^{-\frac{1}{2}} \frac{r}{\ell}$$
$$\times \exp\left[-\frac{m}{2k_{B}T}\left(\frac{\ell^{2}}{r^{2}} + k^{2}\right)^{-1} \left(\delta + \frac{\ell}{r}V_{\phi}\right)^{2}\right]. \quad (4)$$

観測されるドップラースペクトルは方位角 方向への原子の速度によって $-(\ell/r)V_{\phi}$ だけ シフトすることが分かる.また,OVLASを行 った場合に観測される吸収スペクトルは, $r \rightarrow \infty$ のとき最大吸収率Aが計測されると考え,以 下のように与えられる.

 $f_{abs}(\delta)$ 

$$= A \cdot k \left(1 + \frac{r^2}{\ell^2} k^2\right)^{-\frac{1}{2}} \frac{r}{\ell}$$
$$\times \exp\left[-\frac{m}{2k_B T} \left(\frac{\ell^2}{r^2} + k^2\right)^{-1} \left(\delta + \frac{\ell}{r} V_{\phi}\right)^2\right]. \quad (5)$$

Fig.1にEq.5によって計算されたビーム断面 上に生じる吸収率分布を示す.このとき、トポ ロジカルチャージはℓ = +10,離調周波数は +300 MHzである.ビーム断面上には不均一な 吸収率の二次元分布が生じることが分かる.こ のような不均一な吸収はビーム断面に基本LG モードとは異なる構造を生成する.



Fig.1. 吸収率分布

5. プラズマ中におけるLGビームの伝 播

LGビームのビーム断面がプラズマ中を不均 ーに吸収されながら伝播していくことによる ドップラースペクトルへの影響を評価する. LGビームの伝播を計算するために,回折伝播 計算手法の一つである角スペクトル法を用い る. Eq.6に定式化された角スペクトル法を示 す[4].

$$g(x, y, z) = \mathcal{F}^{-1} \left[ \mathcal{F}[g(x, y, 0)] \\ \cdot \exp\left[j\sqrt{\lambda^{-2} - f_X^2 - f_Y^2}z\right] \right]$$
(6)

ここで、g(x,y,0)、g(x,y,z)はそれぞれ伝播前の 複素振幅分布、伝播後の複素振幅分布、 $\lambda$ は波長、  $f_x$ 、 $f_y$ は空間周波数を表す.複素振幅分布はあら ゆる伝播方向を持つ平面波の重ね合わせである と考えられる.フーリエ変換によって、平面波群 に展開し、指数関数部によって各平面波の位相変 化を計算する.最後に、逆フーリエ変換によって 伝播後の複素振幅分布を得る.Eq.5によって記述 されるLGビームのビーム断面上に生じる不均一 な吸収の効果を乗算しつつ、Eq.6によってビーム の伝播を計算することでプラズマ中を吸収され ながら伝播したLGビームを得る.







Fig.2にOVLASの実験系を示す.外部共振器 型半導体レーザー(ECDL)の出力光をシング ルモードファイバにカップリングさせ,ガウシ アンビームとし,SLMに再生されたCGHの一 次回折光からLGビームを取り出す.アルゴン の誘導結合プラズマをテストプラズマとして 用いる.LGビームをプラズマに入射させ,プ ラズマを吸収されながら透過したLGビームは カメラに結像される.このとき,吸収長は 20mm,プローブビームのレイリー長は37cm である.レーザーの周波数掃引とカメラのシャ ッターを同期させ,CMOSカメラによって離調 周波数ごとの強度分布を撮影する.1ピクセル ごとの強度変化から吸収スペクトルを測定し、 ドップラーシフト分布を解析する.



7. 数値計算結果及び実験結果

Fig.3. 数値計算によって得られたドップラ ーシフト分布. (a)伝播の影響を考慮しな い場合. (b)伝播の影響を考慮した場合.



Fig.4.  $x = 0 \mu m$  における y 軸方向への ドップラーシフト

LGビームを横切る流速 $V_x = 110$  m/s, 吸収 長を20mm, トポロジカルチャージ $\ell = \pm 10$ を 条件とした数値計算によるドップラーシフト 分布をFig.3に示す. Fig.3(a)は伝播の影響を考

慮せずに, Fig.3(b)は伝播の影響を考慮して計 算した.ドップラーシフト分布は全体として時 計回りに回転していることが分かる. ドップラ ーシフト分布はビーム断面の位置ごとに観測 される吸収スペクトルから解析しており、ビー ム断面に生じる不均一な吸収による構造が Gouy位相によって回転したことが影響してい ると考えられる. 伝播による測定への影響につ いて評価するために、Fig.3のドップラーシフ ト分布を $x = 0 \mu m$ でy軸方向に見た結果を Fig.4に示す. 位相特異点近傍では, 伝播の影響 でドップラーシフトの絶対値が小さくなって いることが分かるが、位相特異点から200µm ほど離れた位置からは伝播の影響をほぼ無視 できるほどに絶対値の差が小さくなっている ことが分かる.

実験によって得られたドップラーシフト分 布をFig.5に示す.この実験では、共鳴吸収周波 数の校正を行っていないため、ドップラーシフ トの相対値に注目する.Fig.5では、紫の破線で 示された2重の円内の領域が有効なデータで ある.光渦の上下で相対的なドップラーシフト に±2MHz程度の差があることが分かる. Fig.3(b)で示される数値計算の結果と比較して、 2倍程度の大きさの絶対値となっているが、従 来の我々の実験では2桁程度大きなドップラー シフトが計測されており、理論値に近いドップ ラーシフトが計測されているといえる.



Fig.5. 実験によって得られたドップラー シフト分布

## 8. まとめと今後の展望

一般的なTDLASで用いられているガウシア ンビームをLGビームに置き換えることで、従 来のTDLASでは困難であった、プローブビー ムを横切る流れの測定を行える可能性がある.

OVLASでは、一般的なTDLASと異なり、ビ ーム断面上に不均一な吸収が生じ,ビーム断面 に基本LGモードとは異なる構造を生成する. 我々は、高次のLGビームがプラズマ中を吸収 されながら伝播することによって,このような 構造が変化することを数値計算によって示し た. 伝播の影響によるGouy位相の変化によっ てドップラーシフト分布が回転する他,絶対値 が小さくなることが分かった.また,位相特異 点から±200 μm離れた領域ではドップラーシ フトの絶対値の変化が小さくなることが分か った.このようなドップラーシフトの変化は Gouy位相に依存しているため、今後は、レイ リー長の条件を変化させた場合の数値計算を 行い、伝播によるドップラーシフトの絶対値の 変化がレイリー長に依存しているかを検討す る.

トポロジカルチャージℓ = ±10の高次のLG ビームを用いたOVLASを行った.ドップラー シフトの絶対値は理論的な予測に対して2倍程 度大きなものとなっている.しかし,トポロジ カルチャージℓ = ±1のLGビームを用いた我々 の従来の実験によって得られたドップラーシ フトの絶対値は理論的な予測に対して2桁程度 大きなものとなっているため,実験の測定精度 は格段に向上しているといえる.本実験によっ て得られたドップラーシフト分布には空間的 なノイズが含まれてしまっているため,測定の SNRを向上させる必要がある.また,今後は, 流速依存性を確認し,実際のガス流速と比較す る必要がある.

本講演では、数値計算の結果及び実験結果に ついて詳細に報告する.

参考文献

- [1] A.E. Siegman, lasers (University Science Books, Mill Valley, CA, 1986).
- [2] L. Allen, M. Babiker, and W. L. Power, Opt. Commun. 112, 141 (1994).
- [3] S. Yoshimura, K. Terasaka, and M. Aramaki, Jpn. J. Appl. Phys., vol. 59, no. SH, p. SHHB04, May 2020.
- [4] K. Matsushima and T. Shimobaba, Opt. Express, vol. 17, no. 22, p. 19662, Oct. 2009.